JP08186066A2: METHOD AND SYSTEM FOR TREATING MICROPARTICLE AND POWDERY DUST IN SEMICONDUCTOR ELEMENT FABRICATION PROCESS

DerwentParticle processing method of semiconductor

Titlescomponent mfg. method - by passing gas from particle
source in rotation brush before passing in filter layer to
separate moisture part and oil [Derwent Record]

<u>Gountry:</u>JP Japan

Kind: A (Seé also: JP03201701B2)

Inventor AWAJI TOSHIO;

Assignee AWAJI TOSHIO

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / 1996-07-16 / 1994-12-28

Filed:

Application JP1994000339812

<u>Number:</u>

Core: more...

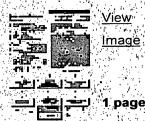
IPC-7: **H01L 21/02**;

Priority 1994-12-28 JP1994000339812

<u>Number</u>

PURPOSE: To capture very fine microparticles and powdery dust for a long term by passing a gas containing microparticles and powdery dust through a rotary brush prior to passing through a laminate filter comprising more than two layers having mesh decreasing gradually from the upstream side toward the downstream side thereby separating the moisture and the oil.

CONSTITUTION: A disc-like rotary brush 36 is disposed rotatably in a liquid separation chamber 32 while traversing between the inlet and outlet. When a



gas touches the brush 36, oil and moisture contained n the gas are captured between the bristles of the rotary brush 36 and separated from the gas. It is then carried by the centrifugal force to the circumferential wall 39 of the liquid separation chamber 32 and flows down gravitationally along the circumferential wall 39. together with a part of powdery dust contained in the gas and collected at the bottom part. Residual fine particles and powdery dust are carried on the gas passing between the bristles of the rotary brush 36 and sucked through the outlet and an intermediate duct 4 nto a dust collector 5. When the oil and moisture are separated by means of the rotary brush 36, pressure oss due to liquid separation 15 low. Consequently, ncrease in the capacity of fan is suppressed and the size of the system can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

EINPADOCNone

GetNow: Family Legal Status Report

Legal |Status:

🦤 🖫 Family: Show 2 known family members

©therCHEMABS 125(20)263052A CAN125(20)263052A Abstract Info: DERABS G96-381344 DERG96-381344

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-186066

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/02

D

審査請求 未請求 請求項の数17 FD (全 12 頁)

(21)出願番号 特願平6-339812

(22)出願日 平成6年(1994)12月28日

(71)出願人 591260328

淡路 敏夫

大阪府堺市引野町2丁130-4

(72)発明者 淡路 敏夫

大阪府堺市引野町2丁130番地の4

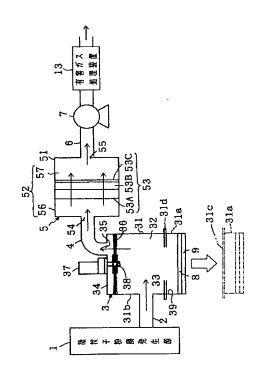
(74)代理人 弁理士 澤 喜代治

(54) 【発明の名称】 半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法及びその装置

(57)【要約】

【目的】 本発明は、構成が簡単で、しかも、小型であ りながら、0.01μm程度以上の微粒子粉塵を長期間 にわたって捕獲できる半導体素子製造工程の微粒子粉塵 処理方法及びその装置を提供することを目的とする。

【構成】 本発明は、半導体素子製造工程において微粒 子粉塵を発生する微粒子粉塵発生源から微粒子粉塵を含 有する気体を目の大きさが上流側から下流側に順に小さ くなる3層以上のフィルタを積層した積層フィルタで濾 過して微粒子粉塵を分離して回収する半導体素子製造工 程の微粒子粉塵処理方法において、微粒子発生源からの 上記気体を上記積層フィルタに通す前に回転ブラシに通 して水分及び油分を分離することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子製造工程において微粒子粉塵を発生する微粒子粉塵発生源から微粒子粉塵を含有する気体を目の大きさが上流側から下流側に順に小さくなる3層以上のフィルタを積層した積層フィルタで濾過して微粒子粉塵を分離して回収する半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法において

上記微粒子粉塵発生源からの上記気体を上記積層フィルタに通す前に回転ブラシに通して水分及び油分を分離することを特徴とする半導体素子製造工程の微粒子粉塵処 10理方法。

【請求項2】 回転ブラシを縦軸心回りに回転させ、この回転ブラシの下側から上側に気体を通過させる請求項1 に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法。

【請求項3】 回転ブラシが定位置で回転可能に、又は 左右或いは上下に移動可能に形成されている請求項1又 は2に記載の微粒子粉塵処理方法。

【請求項4】 液分離室の底部に、吸水性ポリマー、吸油性ポリマー又は吸水性ポリマーと吸油性ポリマーの積層体を配置し、分離された水分又は油或いは水分と油を 20 この吸水性ポリマー、吸油性ポリマー又は吸水性ポリマーと吸油性ポリマーの積層体に吸収させて廃棄する請求項1ないし3のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法。

【請求項5】 気体を回転ブラシと積層フィルタとの間で積層フィルタの最も上流側のフィルタよりも目が大きい別の予備フィルタに通す請求項1ないし5のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法。

【請求項6】 微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタを廃 30 棄用機器内に密封して廃棄する請求項1ないし5のいず れか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理 方法。

【請求項7】 半導体素子製造工程において微粒子粉塵を発生する微粒子粉塵発生源から導かれる微粒子粉塵を含む気体を濾過する上流側から下流側に目の大きさが順に小さくなる3層以上のフィルタを積層した積層フィルタを有する集塵装置を設けた半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置において、

微粒子粉塵発生源と積層フィルタとの間に配置された筒 40 形の液分離室と、この液分離室内に液分離室の軸心回り に回転可能に設けられた回転ブラシと、この回転ブラシ を回転駆動する駆動装置とを備える液分離装置が設けられていることを特徴とする半導体素子製造工程の微粒子 粉塵処理装置。

【請求項8】 液分離室が縦軸に配置され、この液分離室が回転ブラシの下方で開口し、微粒子粉塵発生源に液分離室を連通させる入口と、上記回転ブラシの上方で開口し、集塵装置に連通する出口とを備える請求項7に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項9】 回転ブラシが円盤状或いは螺旋状に形成されている請求項7又は8に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項10】 液分離装置が液分離室の底部に収納される吸水性ボリマー、吸油性ボリマー又は吸水性ボリマーと吸油性ボリマーの積層体を備える請求項7ないし9いずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項11】 液分離室における回転ブラシよりも下側の部分が分離可能に設けられている請求項7ないし10のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項12】 液分離装置と積層フィルタとの間で気体を濾過する積層フィルタの最も上流側のフィルタよりも目が大きい別の予備フィルタが設けられている請求項7ないし11のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項13】 液分離装置の出口に複数の集塵装置が接続され、複数の集塵装置の中から選択された1つ又は複数の集塵装置に選択的に気流を導く集塵装置選択手段が設けられている請求項7ないし12のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項14】 液分離装置の出口に接続される1つ又は複数の集塵装置の集塵室に複数の積層フィルタが並列的に設けられ、その集塵室の複数の積層フィルタの中から選択された1つ又は複数の積層フィルタに選択的に気流を導くフィルタ選択手段が設けられている請求項7ないし13のいずれか1項に記載の半導体素子製造工程の 徴粒子粉塵処理装置。

30 【請求項15】 集塵装置には、微粒子粉塵を捕獲した 積層フィルタを密封する廃棄用容器が設けられている請 求項7ないし14のいずれか1項に記載の半導体素子製 造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項16】 集塵装置の匣体と別体に形成され、匣体に挿抜される廃棄用容器が設けられている請求項15 に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

【請求項17】 集塵装置の匣体が廃棄用容器に兼用されている請求項16に記載の半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理装置。

40 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子製造工程の 微粒子粉塵処理方法及びその装置に係り、特に、粒径 0.01μm以上の微粒子粉塵を長期間にわたって捕獲 して廃棄できるようにした半導体素子製造工程の微粒子 粉塵処理方法及び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータ及びこれを応用する 電子制御装置は目を見張るように発達してきており、そ 50 の発展の方向及び範囲は無限に広がるように思われる。

.

このため、コンピュータに使用される電子部品として主 要な地位を占める半導体電子素子の製造技術及びその生 産量も著しく急速に成長している。

【0003】これら半導体素子の原料となる半導体とし ては、ゲルマニウム(Ge)、シリコン(Si)が多用 され、また、特殊な素子にはガリウム砒素(GaA s)、ガリウム燐(GaP)なども実用化されている。 【0004】半導体素子製造工程は、例えば半導体の円 柱を形成する半導体柱形成工程、これをスライスして半 導体ウエハを形成するウエハ形成工程、この半導体ウエ 10 ハにマスキング、薄膜形成、ドーピング、エッチングな どを繰り返すことにより多数の素子を形成する素子形成 工程、素子が形成された半導体ウエハを各素子に分断す

[0005]とのような半導体製造工程においては、例 えば0.01~50μm程度の非常に微細な微粒子粉塵 が発生することが知られており、また、この微粒子粉塵 は、それ自体が公害防止の観点から放散することが禁止 される有害物質であったり、これを含有する気体が有害 着したりしていることが知られている。

る裁断工程などからなる。

【0006】半導体製造工程において使用され、或いは 生成される有害物質としては、以下に例示するシリコン 系、砒素系、燐系、硼素系、水素化金属系、フロン系、 ハロゲン、ハロゲン化物、窒素酸化物、その他のものが ある。

【0007】シリコン系有害ガスとしては、モノシラン (Sill,)、ジクロルシラン、三塩化一水素ケイ素(SillC 1,)、四塩化ケイ素(SiCl,)、四フッ化ケイ素(SiF,)、ジ シラン(Si, H,)、TEOS (Si(OC, H,)などが代表的であ る。

【0008】砒素系有害ガスとしては、アルシン(As H₃)、フッ化砒素(III)(AsF₃)、フッ化砒素(V)(AsF₅)、 塩化砒素(III)(AsCl,)、塩化砒素(V)(AsCl,)などが代表 的であり、燐系有害ガスとしては、ホスフィン(PH₂)、 フッ化燐(III)(PF,)、フッ化燐(V)(PF,)、塩化燐(III) (PCl,)、塩化燐(V)(PCl,)、オキシ塩化燐(POCl,)などが 代表的である。

【0009】硼素系有害ガスとしては、ジボラン(B 』H。)、三フッ化硼素(BF。)、三塩化硼素(BC1。)、三臭化 硼素(BBr;)などが代表的であり、また、水素化金属系有 害ガスとしては、セレン化水素(H, Se)、モノゲルマン(G et,)、テルル化水素(H, Te)、スチビン(SbH,)、水素化錫 (SnH,)などが代表的であり、フロン系有害ガスとしては 四フッ化メタン(CF₄)、三フッ化一水素メタン(CHF₃)、 ニフッ化二水素メタン(CH, F,)、六フッ化二水素プロパ ン(C, H, F,)、八フッ化プロパン(C, F,)などがその例とし て挙げられる。

【0010】有害ガスであるハロゲン及びハロゲン化物 としては、フッ素(F,)、フッ化水素(HF)、塩素(Cl,)、

塩化水素(HC1)、四塩化炭素(CC1,)、臭化水素(HBr,)、 三フッ化窒素(NF₃)、四フッ化硫黄(SF₄)、六フッ化硫黄 (SF,)、フッ化タングステン(VI)(WF,)、フッ化モリブデ ン(VI)(MoF。)、四塩化ゲルマニウム(GeCl、)、塩化錫(Sn Cl,)、塩化アンチモン(VI)(SbCl,)、塩化タングステン (VI)(WC1。)、六塩化モリブデン(MoC1。)などが代表的で ある。

【0011】有害ガスである窒素酸化物としては、一酸 化窒素(NO)、二酸化窒素(NQ)、一酸化二窒素(N,O)など が挙げられ、その他の有害ガスとしては、硫化水素(H ,S)、アンモニア(NH,)、トリメチルアミン((CH,),N)な どをその例として挙げることができる。

【0012】この他にも、引火性を有するエタン(C ҳ Ң。)、プロパン(С, Ң。)や、窒素(N,)、酸素(O,)、アルゴ ン(Ar)、二酸化炭素(CO,)などが含まれた雰囲気中で微 粒子粉塵が生成されることが知られている。

【0013】公害防止の精神が徹底しつつある今日で は、どれらの有害成分や粉塵を含んだ排ガスをそのまま 大気中に放出することは許可されず、まず、排ガス中か 物質であったり、雰囲気中の有害物質を吸着したり、収 20 ら粉塵を除去し、種々の処理を施して、安全で清浄なガ スにして放出することが求められている。

> 【0014】そこで、従来、排煙ガスなどの排ガス中か ら粉塵を除去するために、サイクロン、スクラバー、ベ ンチュリスクラバー、バグフィルター、電気集塵機、ル ーパ、沈降室などが利用されていることから、半導体製 造工程から生じる排ガス中から粉塵を除去する場合にも これらの装置を利用することが提案されている。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これらの装置 で捕獲できる塵埃の限界粒径は、サイクロンでは3.0 μm、スクラバーでは1. Ομm、ベンチュリスクラバ ー、バグフィルター及び電気集塵機では0. 1μm、ル ーパでは10μm、沈降室では50μmであり、これら の従来の装置では0.01~50μm程度の非常に微細 な微粒子粉塵を捕獲することはできない。

【0016】そこで、目の大きさが0.01 µm程度の フィルタを用いることを考えたが、この考えには次のよ うな問題があることが分かった。

【0017】即ち、現在の技術レベルはせいぜい目の大 40 きさが 1 μ m 程度のフィルタを形成できる程度であり、 目の大きさが0.01μm程度のフィルタを形成すると とが不可能である。

【0018】又、仮に目の大きさが0.01µm程度の フィルタを形成できたとしても、このように目が小さい フィルタでは圧力損失が著しく大きくなり、微粒子粉塵 発生源からフィルタに微粒子粉塵を運ぶ気流を形成する ためには著しく能力が大きく、従って、著しく大型の排 気装置或いは圧送装置を用いる必要がある。その結果、 装置の敷設面積が大きくなるとともに、設備費用が著し 50 く高くなるので、実用的でない、ということが分かっ

た。

【0019】しかも、この場合、微粒子粉塵がフィルタ に捕獲されることによって短期間に圧力損失が一層大と なってその交換が必要となる。

【0020】そこで、本発明者は研究を重ねた結果、本 発明に先立って、集塵装置のフィルタを目の大きさが上 流側から下流側に順に小さくなる3層以上のフィルタを 積層した積層フィルタで構成し、このフィルタで微粒子 粉塵発生源から導かれた気体を濾過する半導体素子製造 工程の微粒子粉塵処理方法及びその装置を発明し、実用 10 化に向けて試験を行ったところ、予期した通り0.01 μm以上の粉塵を確実に捕集できることが認められた (特開平6-296815号公報)。

【0021】しかし、この試験を繰り返す中で、予想以 上に積層フィルタの目詰まりの進行が速くなり、積層フ ィルタの交換を予想した以上に頻繁にしなければならな いことが認められた。

【0022】そとで、更に研究を重ねた結果、半導体製 造工程で生成する微粒子粉塵を含有する気体には真空ボ ンプやオイルロータリーなどから漏れた油分、研磨、切 20 断などに用いる水性或いは油性の工作液などの液体成分 が微小滴状になって浮遊したり、ダクトの周面に付着し た後、気流に押されたりして積層フィルタまで運ばれ、 微粒子粉塵と混ざって積層フィルタに層状にベッタリと 付着し、目詰まりの進行を加速していることが分かっ

【0023】本発明は、上記技術的事情に鑑みて完成さ れたものであり、構成が簡単で、しかも、小型でありな がら、0.01μm程度以上の微粒子粉塵を長期間にわ たって捕獲できる半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理 30 方法及びその装置を提供することを目的とする。

【0024】ところで、この明細書において、本発明と は、本発明に係る半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理 方法と本発明に係る半導体素子製造工程の微粒子粉塵処 理装置の両方を含む意味で有る。

[0025]

【課題を解決するための手段】まず、本発明に係る半導 体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法(以下、本発明方 法という。) について説明する。

【0026】本発明方法は、半導体素子製造工程におい 40 て微粒子粉塵を発生する微粒子粉塵発生源から微粒子粉 塵を含有する気体を目の大きさが上流側から下流側に順 に小さくなる3層以上のフィルタを積層した積層フィル タで濾過して微粒子粉塵を分離して回収する半導体素子 製造工程の微粒子粉塵処理方法において、上記の目的を 達成するため、微粒子粉塵発生源から上記気体を上記積 層フィルタに通す前に回転ブラシに通して水分及び油分 を分離するととを特徴とする方法である。

【0027】との場合、上記回転ブラシを縦軸心回りに 回転させ、との回転ブラシの下側から上側に上記気体を 50 【0036】又、本発明装置においては、所望により、

通過させるようにしても良いのである。

【0028】との回転ブラシとしては、回転によって水 分及び油分を分離し得る構造であれば特に限定されるも のではなく、円盤状或いは螺旋状等、種々の構造のもの が挙げられるのであり、又、この回転ブラシは定位置で 回転しても良く、或いは左右又は上下に移動するように 構成されても良いのである。

[0029] 本発明方法においては、所望により、上記 液分離室の底部に、吸水性ポリマー、吸油性ポリマー又 は吸水性ポリマーと吸油性ポリマーの積層体を配置し、 分離された水分又は油或いは水分と油をこの吸水性ポリ マー、吸油性ポリマー又は吸水性ポリマーと吸油性ポリ マーの積層体に吸収させて廃棄するようにしても良いの である。

【0030】又、本発明方法においては、気体を回転ブ ラシと積層フィルタとの間で積層フィルタの最も上流側 のフィルタよりも目が大きい別の予備フィルタ(予備集 塵手段)に通し、これによって、予め、比較的大きな粉 塵を捕獲するようにしても良いのである。

【0031】本発明方法においては、作業者や使用後の 積層フィルタの安全性や取扱性を良好にするために、微 粒子粉塵を捕獲した積層フィルタを廃棄用機器内に密封 して廃棄するようにしても良いのである。

【0032】次に、本発明に係る半導体素子製造工程の 微粒子粉塵処理装置(以下、本発明装置という。)につ いて説明する。

【0033】本発明装置は、半導体素子製造工程におい て微粒子粉塵を発生する微粒子粉塵発生源から導かれる 微粒子粉塵を含む気体を濾過する上流側から下流側に目 の大きさが順に小さくなる3層以上のフィルタを積層し た積層フィルタを有する集塵装置を設けた半導体素子製 造工程の微粒子粉塵処理装置において、上記本発明方法 を実施するため、微粒子粉塵発生源と積層フィルタとの 間に配置された円筒形の液分離室と、この液分離室内に 液分離室の軸心回りに回転可能に設けられた回転ブラシ と、この回転ブラシを回転駆動する駆動装置とを備える 液分離装置が設けられていることを特徴とするものであ

【0034】本発明装置においては、液分離室が縦軸に 配置され、この液分離室が回転ブラシの下方で開口し、 微粒子粉塵発生源に液分離室を連通させる入口と、上記 回転ブラシの上方で開口し、集塵装置に連通する出口と を備えるように構成しても良いのである。

【0035】本発明装置において、この回転ブラシとし ては、回転によって水分及び油分を分離し得る構造であ れば特に限定されるものではなく、円盤状或いは螺旋状 等、種々の構造のものが挙げられのであり、又、この回 転ブラシは定位置で回転しても良く、或いは左右又は上 下に移動するように構成されても良いのである。

液分離装置が液分離室の底部に収納される吸水性ポリマー、吸油性ポリマー又は吸水性ポリマーと吸油性ポリマーの積層体を備えるても良いのである。

7

【0037】本発明装置においては、液分離室における回転ブラシよりも下側の部分が分離可能に設けられていることにより、この液分離室が至極簡単に分離、交換ができるので、保守管理が至極容易になるのである。

【0038】又、本発明装置においては、液分離装置と積層フィルタとの間で気体を濾過する積層フィルタの最も上流側のフィルタよりも目が大きい別の予備フィルタ(予備集塵手段)が設けられていることにより、予め、比較的大きな粉塵を捕獲できるので、積層フィルタを一層長期間にわたって使用できるのである。

【0039】本発明装置においては、液分離装置の出口に複数の集塵装置が接続され、複数の集塵装置の中から選択された1つ又は複数の集塵装置に選択的に気流を導く集塵装置選択手段が設けられていることにり、半導体素子の製造を円滑に行うことができるので至極有益である

[0040] 又、本発明装置においては、液分離装置の出口に接続される1つ又は複数の集塵装置の集塵室に複数の積層フィルタが並列的に設けられ、その集塵室の複数の積層フィルタの中から選択された1つ又は複数の積層フィルタに選択的に気流を導くフィルタ選択手段が設けられるととにより、半導体素子の製造を円滑に行うととができるので至極有益である。

[0041] 本発明装置においては、集塵装置には、微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタを密封する廃棄用容器が設けられていることにり、微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタの廃棄処理が容易に行えるので有益である。

[0042]特に、本発明装置において、集塵装置の匣体と別体に形成され、且つ匣体に挿抜される廃棄用容器が設けられていることにり、微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタの廃棄処理が一層容易に行えるので、至極有益である。

[0043] との場合、集塵装置の匣体が廃棄用容器に 兼用されているものが、構造が簡単で、しかも取り扱い 易いので望ましい。

[0044]

【作用】本発明によれば、微粒子粉塵発生源から微粒子粉塵を含有する気体が液分離装置に導入されて回転ブラシに接触すると、この気流に含まれている油分及び水分が、回転ブラシの毛に付着し、回転ブラシの回転により与えられる遠心力で気流から分離され、捕獲される。

【0045】したがって、この回転ブラシの下流側に設けられた積層フィルタに油分及び水分が流れなくなり、油分及び水分を含んだ粉塵が積層フィルタにベッタリと付着して当該積層フィルタの目詰まりの進行が加速されることを防止でき、積層フィルタの交換周期を著しく長くすることができる作用を有する。

【0046】又、このように回転ブラシによって油分及 び水分を除去する場合には、水分及び油分の分離に際し

ての圧力損失が小さく、微粒子粉塵発生源から回転ブラシ及び積層フィルタを通って大気中に排出される気流を 形成する送風機の能力の増加を最小限度に抑えることが でき、装置全体の小型化及びコンパクト化を図る上で有 利になる。

[0047]

【実施例】以下、本発明の一実施例に係る半導体素子製 10 造工程の微粒子粉塵処理方法及びその装置を図面に基づ いて具体的に説明する。

[0048] 本発明方法の一実施例に係る半導体素子製造工程の微粒子粉塵処理方法は、図1の構成図に示すように、半導体素子製造工程において微粒子粉塵を発生する微粒子粉塵を含有する気体から油分及び水分を分離する液分離装置3と、この液分離装置3において油分及び水分を分離された気体を中間ダクト4を介して吸入し、微粒子粉塵を除去する集塵装置5と、この集塵装置5に接続された排気ダクト6と、排気ダクト6に介在させた有害ガス処理装置13と、この有害ガス処理装置13の上流側で排気ダクト6に介在させた送風機7とを備えている。

[0049] この送風機7は、気体を微粒子粉塵発生源から導出ダクト2、液分離装置3、中間ダクト4、集塵装置5及び排気ダクト6を経て、大気中に放出させるように構成してあれば、導出ダクト2或いは中間ダクト4に介在させたり、液分離装置3内或いは集塵装置5内に設けたりしてもよい。

30 【0050】上記液分離装置3は、円筒形の匣体31を備え、この匣体31の内部に円筒状に形成された液分離室32が形成され、この匣体31の一端部に液分離室32を導出ダクト2に連通させる入口33が形成されると共に、他端部に液分離室32を中間ダクト4を連通させる出口35が形成されている。

【0051】又、液分離室32内には入口と出口の間で液分離室32を横断するように、円盤状の回転ブラシ36が回転可能に設けられ、更に、この回転ブラシ36を駆動する駆動装置37が液分離室32外に設けられる。

【0052】液分離室32及び回転ブラシ36の軸心は、水平方向に向けてもよいが、回転ブラシ36によって気体から分離された油分、水分及び微粒子粉塵の一部分が回転ブラシ36の下流側に移動することを防止し、確実に回収するためには、液分離室32及び回転ブラシ36の軸心を直立させ、入口33を回転ブラシ36よりも下方に配置し、出口35を回転ブラシ36よりも上方に配置することが至当である。

[0053]従って、この実施例では、液分離室32を 縦軸に配置し、回転ブラシ36を縦軸心回りに回転可能 50 に設け、液分離室32の回転ブラシ36よりも下方の周 面に入口33を開口し、液分離室32の上壁34の中心から偏心した位置に出口35を開口させている。

【0054】ところで、上記回転ブラシ36としては、上述のように円盤状に形成しても良いが、これに代えて、螺旋状等、種々の構造のものに形成しても良く、又、この回転ブラシ36は定位置で回転しても良く、或いは左右又は上下に移動するように構成されても良いのであり、要は、回転によって水分及び油分を分離し得る構造であれば特に限定されるものではない。

[0055]又、上記駆動装置37は、液分離室32の 10下方に設けることも可能であるが、このように液分離室32を縦軸に配置し、回転ブラシ36を縦軸心回りに回転可能に配置し、その下方に入口33を上方に出口35を配置する場合には、回転ブラシ36によって気体から分離された油分、水分及び微粒子粉塵の一部分の回収を容易にするため、液分離室32の上部のみに回転ブラシ36の中心軸38を配置することが有利であるので、液分離室32の上方に駆動装置37が配置されている。

【0056】 ことでは、駆動装置37を上壁34の上側 に配置しているが、駆動装置37を上壁34の下側、即 20 ち、液分離室32内に設けてもよい。

【0057】上記匣体31を形成する素材は特に限定されず、例えば、紙、木、合成樹脂、金属などを用いるととができるが、気体の圧力に耐える程度の機械的強度、特に剛性を有することが必要である。

【0058】との実施例では、機械的強度に優れ、また、耐候性、耐薬品性及び耐酸性、耐アルカリ性及び耐熱性に優れた合成樹脂で匣体31を形成している。

【0059】また、上記匣体31の形状は、内部に液分離室32を形成できる中空形状であれば特に限定されず、立方形、直方形などの多角立方体、円筒形、楕円筒形などに形成すればよいが、製造コストの低減を図るためできるだけ単純な形状に形成することが好ましい。

[0060] との実施例では、匣体31を平板材に曲げたり、回転モールド成形、ハンドレイアップ法などによって簡単に成形できる円筒形に形成している。

【0061】更に、上記匣体31の大きさは予め求められる単位時間の処理量、後述する吸油性ポリマー8、吸水性ポリマー9などの交換周期などの処理能力に対応して設計すればよい。

【0062】上記液分離室32は、匣体31の内部に形成してあれば良く、匣体31の内部に液分離室32を区画する隔壁を設けてもよいが、この実施例では、構成を簡単にするとともに、小型化、コンパクト化及び軽量化を図るため、匣体31そのものが液分離室32の周囲壁を構成するようにしている。

【0063】上記回転ブラシ36の毛の素材は、特に限定されず、例えば天然又は合成の繊維、鋼、真鍮、銅などの金属線など、一般にブラシの毛に使用されているものの中から自由に選択することができる。

[0064] この実施例では、回転ブラシ36の毛先や液分離室32の周囲壁の摩耗を長期間にわたって防止するために、合成樹脂製の毛を用いた回転ブラシ36が使われている。

【0065】との回転ブラシ36に気体が接触すると、気体に含まれた油分及び水分は回転ブラシ36の毛の間に捕捉され、気体から分離される。回転ブラシ36に捕捉された油分及び水分は回転ブラシ36の回転に伴う遠心力で液分離室32の周壁39に沿って自重で液分離室32の底部に流下し、油分と水分とが上下に分離して溜まる。

[0066] 又、気体に含まれた粉塵の一部分も回転ブラシ36の毛の間に捕捉されたり、回転ブラシ36に付着した油分或いは水分に吸着されたりして、油分或いは水分と共に液分離室32の周壁39に運ばれ、更に、液分離室32の底部に流れ落ちる。

【0067】残りの微粒子粉塵は回転ブラシ36の毛の間を通る気体に乗って出口35から中間ダクト4を経て集塵装置5に吸引される。

[0068] このようにして回転ブラシ36により油分及び水分を分離する場合には、液分離に伴う圧力損失が小さいので、微粒子粉塵発生源1から回転ブラシ36及び積層フィルタ53を通って大気中に排出される気体を形成する送風機の能力の増加を最小限度に抑えることができ、装置全体の小型化及びコンパクト化を図る上で有利になる。

[0069] との実施例においては、油分の廃棄処理を容易にするために、液分離室32の底部に、必要に応じて、吸油性ポリマー8が配置され、液分離室32の底部に流下した油分を吸油性ポリマー8に吸着させ、この吸油性ポリマー8と共に油分を液分離室32から取り出して廃棄できるようにしている。

【0070】 C C で使用される吸油性ポリマー8とは油を吸収し、保持するものであれば特に限定されるものではなく、この場合、公知のものが使用可能である。

【0071】又、この実施例においては、水分の廃棄処理を容易にするために、液分離室32の底部に、必要に応じて、吸水性ポリマー9が配置され、液分離室32の底部に流下した水分を吸水性ポリマー9に吸着させ、この吸油性ポリマー8と共に水分はこの吸水性ポリマー9と共に水分を液分離室32から取り出して廃棄できるようにしている。

[0072] とこで使用される吸水性ポリマー9とは水を吸収し、保持するものであれば特に限定されるものではなく、この場合、公知のものが使用可能である。

[0073] 液分離室32の底部に吸油性ポリマー8或いは吸水性ポリマー9を配置する形態は特に限定されるものではなく、具体的には、例えば粒状或いは粉末状のものを液分離室32の底部に適当な厚さに敷き詰めた

50 り、吸油性ポリマー8或いは吸水性ポリマー9を担持し

た多孔質体を液分離室32の底部に配置したり、吸油性 ポリマー8或いは吸水性ポリマー9を配合した合成樹脂 フィルムないしシートを液分離室32の底部に配置した りすればよい。

【0074】とれらの形態の中では、廃棄処理時の作業 性を高めるために、吸油性ボリマー8或いは吸水性ボリ マー9を担持した多孔質体、又は、吸油性ポリマー8或 いは吸水性ボリマー9を配合した合成樹脂フィルムない しシートを液分離室32の底部に配置する方法が推奨さ れる。

【0075】上記匣体31には、液分離室32内の廃棄 物を取り出すために、液分離室32の底部を外部に連通 させる開口部とこの開口部を密封する蓋体とを設けても よいが、この実施例では、回収作業者が廃棄物に接触す る機会を少なくして、作業の安全性を高めるために、匣 体31の入口33よりも下側の下部31aを、パッキン 31 dを介して、その上部31 bから分解できるように し、廃棄物を入れた匣体31の下部31aに蓋31cを して、匣体31の下部31aごと運搬できるように構成 している。

【0076】もっとも、廃棄物の回収にあたって液分離 装置3全体を交換することは妨げない。

【0077】又、上記液分離室32の底面をじょうご状 に形成し、その下端に連設した取出口から、随時、廃棄 物を取り出せるようにしてもよい。

【0078】上記集塵装置5には、筒状の匣体51とと れの内部に形成された集塵室52に配置される積層フィ ルタ53とが設けられ、との匣体51の一端には液分離 室32の出口35に集塵室52を連通させる導入口54 が、他端には集塵室52を排気ダクト6を介して、送風 30 機7、有害ガス処理装置13を経て大気中に連通させる 導出口55が形成される。

【0079】上記匣体51を形成する素材は特に限定さ れるものではなく、具体的には、例えば、紙、木、合成 樹脂、金属などを用いることができるが、気体の圧力に 耐える程度の機械的強度、特に剛性を有することが必要 である。

【0080】との実施例では、機械的強度に優れ、ま た、耐候性、耐薬品性及び耐酸性、耐アルカリ性及び耐 熱性に優れた合成樹脂で匣体51を形成している。

【0081】また、上記匣体51の形状は、内部に集塵 室52を形成できる中空形状であれば特に限定されず、 立方形、直方形などの多角立方体、円筒形、楕円筒形な どに形成すればよいが、製造コストの低減を図るためで きるだけ単純な形状に形成することが好ましい。

【0082】との実施例では、図1に示すように、匣体 51を平板材を折り曲げたり、繋ぎ合わせたりして簡単 に成形できる直方形に形成しているが、 例えば図3又は 図9に示すように縦軸の筒状に形成する場合には敷設面 積を狭くでき、特に図9に示すように、液分離装置3の 50 53 Cの厚さが積層フィルタ53の全厚さの1~25%

12

上側に直結する場合には一層敷設面積を狭くできる。 【0083】なお、上記匣体51の大きさは予め求めら れる単位時間の処理量、積層フィルタ53の交換周期な どの処理能力に対応して設計すればよい。

【0084】上記集塵室52は、匣体51の内部に形成 してあれば良く、匣体51の内部に集塵室52を区画す る隔壁を設けてもよいが、この実施例では、構造を簡単 にするとともに、小型化、コンパクト化及び軽量化を図 るため、匣体51そのものが集塵室52の周囲壁を構成 10 するようにしている。

【0085】上記積層フィルタ53は、集塵室52に導 入された気体を漏れなく貫流させるために、集塵室52 内を導入室56と浄気室57との2室に気密状に区画し て設けられている。

【0086】ととで、積層フィルタ53は集塵室52内 に設けられる隔壁とともに集塵室52内を上記2室に区 画するようにしてもよいが、この実施例では、構成を簡 単にするため、積層フィルタ53のみによって集塵室5 2内が2室56、57に区画される。

【0087】上記積層フィルタ53のフィルタ53A・ 53B・53Cの積層数は3層以上とするのが好まし く、1層又は2層のフィルタでは粒径0.01μmの微 粒子粉塵を捕獲できない場合が有るので好ましくない。 【0088】また、積層フィルタ53の上流側に目の小 さいフィルタ53B又はフィルタ53Cを配置すること は、そのフィルタ53B又はフィルタ53Cの目の大き さで比較的小さな微粒子粉塵を捕獲できるが、目詰まり が早く、使用可能な期間が短くなるので好ましくない。 【0089】積層フィルタ53の各フィルタ53A・5 3 B・5 3 Cの目の大きさは、捕獲される微粒子粉塵の 粒径分布などを考慮して適宜設定される。

[0090] この実施例では、目の大きさが200μm 程度の第1層フィルタ53Aと、目の大きさが50~2 00 mmの第2層フィルタ53Bと、目の大きさが1~ 50μm程度の第3層フィルタ53Cとが積層されてい

【0091】積層フィルタ53の厚さは、微粒子粉塵発 生源1と大気圧との圧力差、積層フィルタ53の通気性 ないし圧力損失、積層フィルタ53の機械的強度等を考 40 慮して決定すればよく、5 mm以上とすることが好まし

【0092】又、積層フィルタ53の各フィルタ53A ・53B・53Cの厚さも、同様に微粒子粉塵発生源1 と大気圧との圧力差、各フィルタ53A・53B・53 Cの通気性ないし圧力損失、各フィルタ53A・53B ・53Cの機械的強度とを考慮して決定すればよいが、 第1層フィルタ53Aの厚さが積層フィルタ53の全厚 さの20~50%、第2層フィルタ53Bの厚さが積層 フィルタ53の全厚さの30~60%、第3層フィルタ

化されなくても良い。

とすることが適当である。

【0093】この実施例では、第1層フィルタ53Aは 厚さ約4mmであってボリプロピレン繊維を重ねて形成 されており、第2層フィルタ53Bは厚さ約3mmであ ってポリプロピレン繊維を重ねて形成されており、第3 層フィルタ53Cは厚さ約1mmであってポリプロピレ ン繊維を重ねて形成されており、この積層フィルタ53 全体の厚さは約8mmに形成されている。

13

【0094】上記積層フィルタ53の形状は特に限定さ れるものではなく、板形、筒形、錐形、錐台形、球形な 10 ど自由に形成することができ、板形としては平板形、曲 板形、波板形などに形成できる。また、筒形、錐形、錐 台形の場合にはその一端又は両端を開放することがで き、その断面形状は円形、楕円形、弦月形、三角以上の 多角形、芒星形など自由に形成することができる。

【0095】この実施例においては、説明を簡単にする と共に、形状を簡単にして製造コストを削減するため、 **積層フィルタ53を板状に形成しているが、図3に示す** ように、縦軸の有底筒形に形成する場合には、体積の割 に積層フィルタ53の面積を広くできると共に敷設面積 を狭くできる。

【0096】上記積層フィルタ53を構成する各フィル タ53A・53B・53Cの素材はポリプレビレン繊維 に特に限定されるものではなく、具体的には、例えば、 天然繊維、合成繊維或いはこれらの混合物、延伸合成樹 脂フィルム、発泡合成樹脂、合成樹脂の可溶混練物を溶 出して形成した多孔質体、セラミックス多孔質体などを 用いることができ、又、繊維を用いる場合には、その組 織は編成組織であっても、織成組織であっても、不織組 織であっても、フェルトであってもよい。

【0097】上記天然繊維は有機のものと無機のものと に分類され、有機天然繊維としては、綿、スフ、パルプ などの植物性繊維、羊毛、牛毛、豚毛、馬毛などの絨 毛、絹などの動物性繊維がその例として挙げられ、ま た、無機天然繊維としてはガラス繊維などのセラミック 繊維、ロックウール、アスベストなどがその例として挙 げられる。

【0098】上記合成繊維は有機のものと無機のものと に分類され、有機合成繊維としてはポリアミド繊維、ア クリル繊維、ポリエステル繊維、アセテート繊維などが 40 その例として挙げられ、無機合成繊維としてはカーボン 繊維、ボロン繊維などがその例として挙げられる。

【0099】もっとも、各フィルタの素材は処理される 気体中に含まれる物質と反応して崩壊したり、腐食され たりしない素材を用いることが好ましい。

【0100】なお、ことで複数層のフィルタ53A・5 3B・53Cを積層するということは、各層のフィルタ 53A・53B・53Cが順に密着して設けられるとい う意味であって、必ずしも各層のフィルタ53A・53 B・53Cが例えば接着などの手法により不可分に一体 50 第2層フィルタ53Bの目bの大きさよりも小さい塵埃

【0101】又、上記積層フィルタ53は補強材で補強 することが可能であり、この補強材としては、例えば金 属、合成樹脂などからなる有孔板、網がその例として挙 げられる。この補強材は積層フィルタ53の何れかの層 のフィルタに接着、ビス止め、リベット止め、係着など の方法によって固定してもよく、また、どのフィルタと も結合しなくてもよい。

【0102】更に、上記積層フィルタ53は樹脂含浸に より補強してもよく、この場合、樹脂はいずれか1層の フィルタのみに含浸させてもよく、複数層のフィルタに 含浸させてもよく、又、全層のフィルタに含浸させても よい。

【0103】上述したように、微粒子粉塵発生源1から ダクト2、液分離装置3及び中間ダクト4を介して集塵 室52に導入された気体からは、油分と、水分と、粉塵 の一部分が除去されているが、粉塵、特に粒径0.01 μm以上の微粒子状の粉塵を多量に含んでいる。

【0104】積層フィルタ53に微粒子粉塵を含む気体 を貫流させると、図2に示すように、第1層フィルタ5 3 A の目 a の大きさよりも粒径の大きい塵埃は全て第1 層フィルタ53Aに捕獲され、捕獲された塵埃が第1層 フィルタ53Aの目aを塞ぐ面積は次第に広くなる。

【0105】 これにより、第1層フィルタ53Aの目a の平均的大きさは小さくなるが、ことで塵埃が球形であ り、フィルタの目が正方形であると仮定し、第1層フィ ルタ53Aの目aと同じ大きさの塵埃が第1層フィルタ 53Aの目aに捕獲されたと考えると、塵埃が詰まった 目ではその目の大きさの約0.11倍以下の塵埃が通過 30 できることになる。

【0106】との値は第1層フィルタ53Aがほぼ完全 に目詰まりした状態での理論的な集塵限界粒径である が、この状態では圧力損失が非常に大きくなり、微粒子 粉塵を含有した気体を積層フィルタ53に貫流させるた めには非常に大型で、高出力の送風機7が必要になる。 【0107】そとで、装置の小型化及び小能力化を図る

ため、実際には、積層フィルタ53の圧力損失が小さい うちに積層フィルタ53の交換時期が設定され、この交 換時期では送風機7に過度の負担を与えないようにされ る。

【0108】図2の模式図に示すように、第1層フィル タ53Aと第2層フィルタ53Bとの境界では、第1層 フィルタ53Aの目aはこれよりも目の大きさが小さい 第2層フィルタ53Bの目りによって分割され、また、 第2層フィルタ53Bの目bの一部分が第1層フィルタ 53Aの目aによって分割される。

【0109】このため、第1層フィルタ53Aと第2層 フィルタ53Bとの境界での目の平均値は第2層フィル タ53Bの目bの大きさよりも小さくなり、この境界に

14

が多量に捕獲され、これにより、この境界の実質的な目の大きさは第2層フィルタ53Bの目りの大きさよりもかなり小さくなる。

【0110】フィルタ53A・53B・53Cの積層数、各層のフィルタ53A・53B・53Cの目a・b・cの大きさなどにより最終層のフィルタ(ここでは第3層フィルタ53C)とその前層のフィルタ53Bとの境界でも実質的な目の大きさが決定され、積層フィルタ53の集塵限界粒径が決まる。

【0111】現実には最終層のフィルタ53 Cの目e の 10 大きさが 1 μ m以上のものしか製造できないが、適宜第 2 層のフィルタ53 Bの目の大きさと第3 層のフィルタ53 Cの目の大きさを選定することにより集塵限界粒径 e 0 . 01 μ m e 5 0 μ m 程度とすることができ、この実施例では集塵限界粒径e 0 . 01 μ m e 5 0 μ m e 0 0 1 μ m e 5 0 μ m e 0 0 0 0 0 0 μ m e 0 0 0 0 0 μ m e 0 0 0 0 μ m e 0 0 0 0 0 μ m e 0 0 0 0 0 μ m e 0 0 0 0

[0112] この積層フィルタ53に導かれた気体は、油分及び水分が除去されているので、積層フィルタ53 に油分や水分が付着するおそれはないので、積層フィルタ53の目詰まりの進行が油分や水分によって加速され 20ることがなく、長期間にわたって0.01μm以上の微粒子粉塵を捕集できるようになる。

【0113】なお、本発明において積層フィルタ53のフィルタ53A・53B・53Cの層数は3層に限定されず、4層以上にしてもよい。

【0114】とのようにして油分、水分及び微粒子粉塵を除去された気体には、有害ガスが含まれているので、 との気体を有害ガス処理装置13に導入し、有害ガス処理装置13内で主として酸化、還元、中和などの化学処理や活性炭やセオライト等による吸着や吸収によって無 30害化してから、排気ダクト6から大気中に放出するようにしている。

【0115】との装置において、積層フィルタ53は、この実施例のように、1つの集塵室52内に1つの積層フィルタ53を設けるだけでもよいが、例えば図4、図5又は図6の各模式図に示すように、1つの集塵室52に複数の積層フィルタ53を並列的に設けることは妨げない。

【0116】1つの集塵室52に複数の積層フィルタ53を並列的に設ける場合には、図5及び図6に示すように、この複数の積層フィルタ53の中から選択された1又は複数の積層フィルタ53に選択的に気体を導くフィルタ選択手段58を設け、これら複数の積層フィルタ53の中の1つを交換している間に他の積層フィルタ53に気体を貫流させて、長期間にわたって集塵能力を一定以上に保持させると共に、半導体の製造を中断することなく積層フィルタ53を交換できるようにすることができる。

[0117] とのフィルタ選択手段58は、並列的に設けられた複数の積層フィルタ53の中から選択された1

又は複数の積層フィルタ53に選択的に気体を導くよう に構成してあればよい。

【0118】例えば図5に示すように、導入室56を1つ(又は複数)の積層フィルタ53ととに複数の導入小室56a~56cに区画する隔壁58aと、各導入小室56a~56cを中間ダクトに連通させる分岐導入路58bと、分岐導入路58bの分岐点に設けられ、中間ダクトに導入小室56a~56cを選択的に連通させる方向制御弁58cとで構成することができる。

[0119] 又、例えば図6に示すように、浄気室57を1つ(又は複数)の積層フィルタ53とごに複数の浄気小室57a~57cに区画する隔壁58dと、各净気小室57a~57cを排気ダクト6に連通させる分岐導出路58eと、分岐導出路58eの集合点に設けられ、且つ排気ダクト6に浄気小室57a~57cを選択的に連通させる方向制御弁58fとでフィルタ選択手段58を構成してもよい。

【0120】もちろん、このフィルタ選択手段5.8としては、フィルタを選択できる構造であれば特に限定されるものではない。

【0121】更に、図9に示すように、液分離装置3の出口55に複数の集塵装置5を接続し、複数の集塵装置の中から選択された1つ又は複数の集塵装置5に選択的に気体を導く集塵装置選択手段を設けて、集塵装置5の中から選択された1つ又は複数の集塵装置5に選択的に気体を流して、長期間にわたって集塵能力を一定以上に保持させると共に、半導体の製造を中断することなく積層フィルタ53を交換できるようにすることができる。

【0122】との場合、更に、各集塵装置5に複数の積層フィルタ53を並列的に設け、選択された積層フィルタ53に気体を貫流させるようにすることも可能である。

【0123】更に、この実施例において、例えば図7、図8及び図9の各模式図に示すように、1つ(又は複数)の集塵室52に設けられた積層フィルタ53と液分離装置3との間に積層フィルタ53の最も上流側の第1層のフィルタ53Aよりも目の大きい別のフィルタを備える予備集塵手段11を設けることは妨げなく、この予備集塵手段11を設けることにより、積層フィルタ53の集塵能力の低下を一層長期間にわたって防止できる。

【0124】との予備集塵手段11は多段に設けてもよく、予備集塵手段11としては、サイクロン、スクラバー、ベンチュリスクラバー、バグフィルター、電気集塵機、ルーパ、沈降室、単層のフィルタを用いることができる他、上記積層フィルタ53と同様に構成された、集塵限界粒径が大きい積層フィルタを用いることができる。

【0125】との場合、比較的粒径の大きい微粒子粉塵がこの予備集塵装置11によって捕集されるので、集塵50 装置5の積層フィルタ53に捕集される微粒子粉塵の総

18

量が少なくなり、集塵装置5の積層フィルタ53の交換 周期を一層長くすることができる。

【0126】特に予備集塵手段11として単層のフィル タや積層フィルタを用いる場合には、図8及び図9に示 すように、予備集塵手段11を積層フィルタ53と共に 安全に廃棄できるようにするため、予備集塵手段 1 1 を 集塵室52内に配置することが推奨される。

【0127】本発明においては、微粒子粉塵を捕獲した 積層フィルタ53の廃棄に際して、有害物質に対する不 特定多数の第三者の安全を確保するため、微粒子粉塵を 10 捕獲した積層フィルタ53を密封する廃棄用容器を設け ることが好ましい。

【0128】この廃棄用容器は、匣体51と別体に形成 して匣体51を繰り返し利用できるようにし、これによ り、メンテナンス費用を削減するようにしてもよいが、 この実施例では、安全性を高めるという観点から、例え ば図3に示すように、上記導入口54及び導出口55を 匣体1の近傍で中間ダクト4或いは排気ダクト6にフラ ンジF結合し、この導入路54のフランジF結合点より 下流側の部分と、導出口55のフランジF結合点より上 20 流側の部分とにそれぞれを全開閉する閉止弁59を設 け、上記匣体51を上記廃棄用容器に兼用し、廃棄時に これらの閉止弁59を閉弁して、集塵装置5から有害物 質が放散されることを防止している。

【0129】ところで、図3において、気体を集塵装置 5に導入するにあたり、上記に代えて、逆に、番号55 箇所を気体の導入口とし、番号54箇所を導出口として も良いのである。

【0130】なお、廃棄用容器を匣体51と別体に形成 する場合には、図示はしないが、積層フィルタ53、廃 30 棄用容器、或いはとれらの組立品を匣体51に出し入れ できるように、上記匣体51の一部分に適当な大きさの 開□部と、この開□部を開閉する蓋とが設けられる。

【0131】匣体51と別体に形成された廃棄用容器 は、集塵を行う前に、上記蓋を開いて、積層フィルタ5 3を包んだ状態で、又は、積層フィルタ53を配置する 前に集塵室52内に配置したり、積層フィルタ53の廃 棄時に集塵室52に挿入したりすればよい。

【0132】そして、廃棄される積層フィルタ53を集 塵室52内で廃棄用容器内に密封してから集塵室52か 40 ら取り出したり、集塵室52内で積層フィルタ53を非 密封状に包んで集塵室52外に取り出した後、集塵室5 2外で廃棄用容器を密封したりすればよい。

[0133]

[発明の効果]以上に説明したように、本発明装置は、 微粒子粉塵発生源と積層フィルタとの間に配置された筒 形の液分離室と、液分離室内に液分離室の軸心回りに回 転可能に設けられた回転ブラシと、との回転ブラシを回 転駆動する駆動装置とを備える液分離装置が設けられて いるので、微粒子発生源から気体を積層フィルタに通す 50 体を導く集塵装置選択手段が設けられている場合には、

前に回転ブラシに通して水分及び油分を分離する本発明 方法を実施することができる。

【0134】そして、本発明方法によれば、水分及び油 分が除去された気体が積層フィルタに貫流されるので、 水分及び油分によって積層フィルタの目詰まりの進行が 加速されるおそれがなく、長期間にわたって 0.01μ m以上の微粒子粉塵を捕集して廃棄することができる。 【0135】本発明装置において、特に液分離室が縦軸 に配置され、この液分離室が回転ブラシの下方で開口 し、微粒子粉塵発生源に液分離室を連通させる入口と、 回転ブラシの上方で開口し、集塵装置に液分離室を連通 させる出口とを備える場合には、本発明方法において、 上記回転ブラシを縦軸心回りに回転させ、との回転ブラ シの下側から上側に上記気体を通過させる方法を実施す ることができ、これにより、回転ブラシによって気体か ら分離された油分、水分及び微粒子粉塵の一部分が回転 ブラシの下流側に移動することを防止し、確実に回収す るととができる。

【0136】この場合には、油分及び水分の分離によっ ての圧力損失が小さいので、微粒子粉塵発生源から回転 ブラシ及び積層フィルタを通って大気中に排出される気 体を形成する送風機の能力の増加を最小限度に抑えると とができ、装置全体の小型化及びコンパクト化を図る上 で有利になる。

【0137】又、本発明装置において、特に液分離装置 が液分離室の底部に吸水性ポリマー、吸油性ポリマー及 び吸水性ボリマーと吸油性ボリマーの積層体を備える場 合には、分離された水分或いは油分又は水分と油分をと のポリマーに吸収させて当該ポリマーと共に廃棄する方 法を実施することができ、これにより、分離された水分 或いは油分又は水分と油分の廃棄処理が至極容易にでき るようになる。

【0138】本発明装置において、特に液分離室の回転 ブラシよりも下側の部分が分離可能に設けられている場 合には、廃棄物の搬出作業時に廃棄物を入れたまま液分 離室の回転ブラシよりも下側の部分を搬出するととによ り作業者が廃棄物に接触する機会を極力少なくすること ができる結果、安全性を一層高めることができる。

【0139】又、本発明装置において、特に液分離装置 と積層フィルタとの間で気体を濾過する積層フィルタの 最も上流側のフィルタよりも目が大きい別の予備フィル タが設けられる場合には、本発明方法において、気体を 回転ブラシと積層フィルタとの間で積層フィルタの最も 上流側のフィルタよりも目が大きい別の予備フィルタに 通す方法を実施することができる結果、これにより、積 層フィルタの交換周期を一層長くすることができる。

【0140】本発明装置において、特に液分離装置の出 □に複数の集塵装置が接続され、且つ複数の集塵装置の 中から選択された1つ又は複数の集塵装置に選択的に気 これら複数の集塵装置の中の1つの集塵装置の積層フィルタを交換している間に他の集塵装置の積層フィルタに 気体を流させて、長期間にわたって集塵能力を一定以上 に保持させると共に、半導体の製造を中断することなく 積層フィルタの交換ができるのである。

19

【0141】又、本発明装置において、特に液分離装置の出口に接続される唯一又は複数の集塵装置の集塵室に複数の積層フィルタが並列的に設けられ、その集塵室の複数の積層フィルタの中から選択された1つ又は複数の、積層フィルタに選択的に気体を導くフィルタ選択手段が 10設けられている場合には、その集塵室の複数の積層フィルタの中の一つの積層フィルタを交換している間に他の積層フィルタに気体を流させて、長期間にわたって集塵能力を一定以上に保持させると共に、半導体の製造を中断することなく積層フィルタの交換できるので至極有益である。

【0142】更に、本発明装置において、集塵装置に、 更に、微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタを密封する廃 棄用容器が設けられている場合には、本発明方法におい て、微粒子粉塵を捕獲した積層フィルタを廃棄用容器内 20 に密封して廃棄する方法を実施することができる結果、 作業者が廃棄物に接触する機会を極力少なくして安全性 を一層高めることができる。

【0143】この場合、集塵装置の匣体を廃棄用容器に 兼用すれば、作業者が廃棄物に接触する機会が一層少な くなり、安全性を一層高めることができるのである。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明装置の構成図である。

【図2】図2は、本発明に用いられる第1層と第2層のフィルタの関係を示す模式図である。

【図3】図3は、本発明の他の装置の構成図である。

【図4】図4は、本発明に好適に用いられる他の集塵装*

* 置の構成図である。

【図5】図5は、本発明に好適に用いられる更に他の集 塵装置の構成図である。

【図6】図6は、本発明に好適に用いられる更に他の集 塵装置の構成図である。

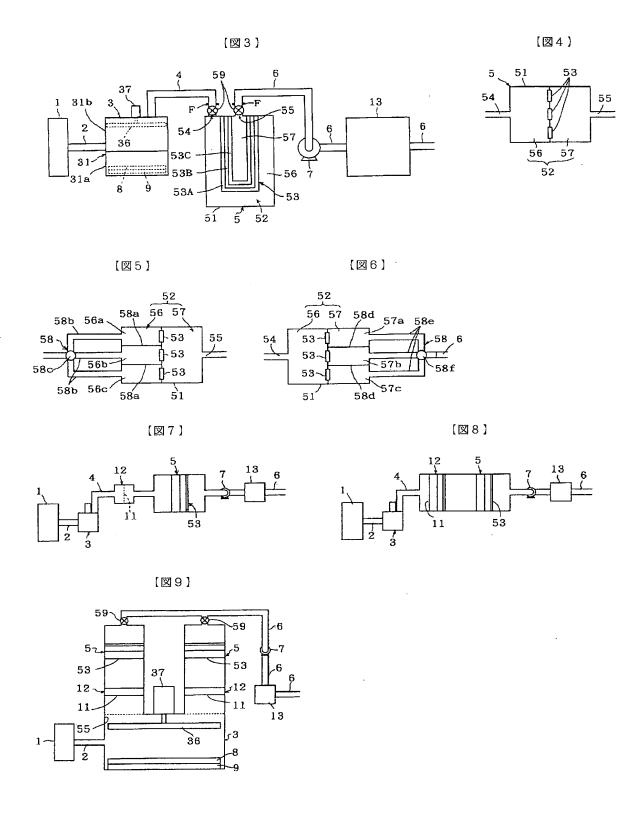
[図7] 図7は、本発明の又他の装置の構成図である。

【図8】図8は、本発明の更に他の装置の構成図である。

【図9】図9は、本発明の他の装置の構成図である。 0 【符号の説明】

- 1 微粒子粉塵発生源
- 3 液分離装置
- 5 集塵装置
- 7. 送風機
- 8 吸油性ポリマー
- 9 吸水性ポリマー
- 31 厘体
- 32 液分離室
- 33 入口
- 0 35 出口
 - 3.6 回転ブラシ
 - 37 駆動装置
 - 51 匣体
 - 52 集塵室
 - 53 積層フィルタ
 - 53A 第1層フィルタ
 - 53B 第2層フィルタ
 - 53C 第3層フィルタ
 - 54 導入口
- 30 55 導出口
 - 56 導入室
 - 57 浄気室

[図1] [図2] 53B 有害ガス 粒 子 100 53A 53B 53C 庭発 31b 32 <u>\$</u> 33 -31d -Ln -31a



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.